

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成25年2月14日 (2013.2.14)

【公開番号】特開2010-188720(P2010-188720A)
 【公開日】平成22年9月2日 (2010.9.2)
 【年通号数】公開・登録公報2010-035
 【出願番号】特願2010-1531(P2010-1531)
 【国際特許分類】

B 4 2 D 15/10 (2006.01)

G 0 2 B 5/18 (2006.01)

【F I】

B 4 2 D 15/10 5 0 1 P

G 0 2 B 5/18

【手続補正書】
 【提出日】平成24年12月21日 (2012.12.21)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 6 0
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 6 0】

表面構造 1 3 および 2 3 は、二元表面構造を含み、その構造エレメントは、ほぼ矩形であり、その構造深度は、100nm～1000nmの範囲である。表面構造 1 3 および 2 3 の構造エレメントの間隔は、50nm～1000nm、好ましくは100nm～300nmの範囲である。また、原版 1 および 2 に形成された表面構造 1 3 および 2 3 は、正確に相互に一致する関係で配置され、相互に反転する表面構造の形態で形成される。図 1 に例を示すが、表面構造 2 3 が、フォトリソ層 3 3 ' の表面に写る表面構造 1 3 に一致しているのがわかる。また、表面構造 1 3 および 2 3 は、区域 4 1 と正確な位置関係で配置される。図 1 で分かるように、表面構造 1 3 および 2 3 は、この場合、各区域 4 1 のセンターラインに対して対称の構造の形態であり、区域 4 1 の中央から各区域 4 1 の隣接する区域との境界に至るに従い、構造エレメントの間隔および構造エレメントの幅が減少する。さらに、表面構造 1 3 および 2 3 は、区域 4 1 の中央に対して、それぞれ部分的な対称構造であってもよい。